

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成17年2月24日(2005.2.24)

【公開番号】特開2002-182000(P2002-182000A)

【公開日】平成14年6月26日(2002.6.26)

【出願番号】特願2000-379679(P2000-379679)

【国際特許分類第7版】

G 2 1 K 5/04

B 0 1 J 19/12

B 2 3 K 15/00

C 2 3 C 14/30

G 2 1 K 5/00

H 0 1 L 21/31

【F I】

G 2 1 K 5/04 E

G 2 1 K 5/04 W

B 0 1 J 19/12 C

B 2 3 K 15/00 5 0 1 D

C 2 3 C 14/30 B

G 2 1 K 5/00 B

H 0 1 L 21/31 A

【手続補正書】

【提出日】平成16年3月18日(2004.3.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

真空容器の内部に電子ビーム発生器が設けられ前面に電子ビーム発生器より発生した電子ビームが透過する電子ビーム出射窓が形成された複数の電子ビーム管が、被処理物进行处理するための処理室に、電子ビーム出射窓が露出するように配置された電子ビーム処理装置であって、

前記各々の電子ビーム管は、中心の電子ビーム管の周りに複数の電子ビーム管が同心円状に配置されており、

中心の電子ビーム管からの離間距離が等しい各々の電子ビーム管同士は出力が同じであって、なおかつ、中心の電子ビーム管からの離間距離が異なる電子ビーム管同士で電子ビーム管の出力が制御され、

被処理物の処理領域全体の吸収線量が所定の分布状態になるように各々の電子ビーム管が配置されていることを特徴とする電子ビーム処理装置。

【請求項2】

真空容器の内部に電子ビーム発生器が設けられ前面に電子ビーム発生器より発生した電子ビームが透過する電子ビーム出射窓が形成された複数の電子ビーム管が、被処理物进行处理するための処理室に、電子ビーム出射窓が露出するように配置された電子ビーム処理装置であって、

前記各々の電子ビーム管は、周囲に配置する他の電子ビーム管の数が同じとなる電子ビーム管同士は出力が同じであって、なおかつ、周囲に配置する他の電子ビーム管の数が異なる

る電子ビーム管同士で電子ビーム管の出力が制御され、被処理物の処理領域全体の吸収線量が所定の分布状態になるように各々の電子ビーム管が配置されていることを特徴とする電子ビーム処理装置。

【請求項3】

前記処理室が圧力調整機構によって減圧されていることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の電子ビーム処理装置。

【請求項4】

前記処理室には被処理物を載置するための載置台が設けられており、当該載置台は、前記電子ビーム出射窓との離間距離を可変することができることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の電子ビーム処理装置。